A virtual reactor for simulation of plasma enhanced chemical vapor deposition

Krzhizhanovskaya, V.V.

Publication date
2008

Citation for published version (APA):
Krzhizhanovskaya, V. V. (2008). A virtual reactor for simulation of plasma enhanced chemical vapor deposition. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].
A Virtual Reactor for Simulation of Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition

ACADEMISCH PROEFSCHRIJT

ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Universiteit van Amsterdam
op gezag van de Rector Magnificus
prof. dr. D.C. van den Boom
ten overstaan van een door het college voor promoties ingestelde commissie, in het openbaar te verdedigen in de Agnietenkapel
op Vrijdag 20 Juni 2008, te 12:00 uur

door

Valeria Vladimirovna Krzhizhanovskaya

geboren te St. Petersburg, Rusland
Promotiecommissie:
Promotor: Prof. Dr. P.M.A. Sloot
Co-promotor: Prof. Dr. Yu.E. Gorbachev
Overige leden: Prof. Dr. S.E. Alexandrov
Prof. Dr. M.T. Bubak
Prof. Dr. W.J. Goedheer
Dr. A.G. Hoekstra
Dr. J.-P. Taran
Prof. Dr. R.J. Meijer
Faculteit: Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

The work described in this thesis has been carried out in the Section Computational Science of the University of Amsterdam and St. Petersburg State Polytechnic University, with the financial support of EU IST CrossGrid (IST200132243), Dutch Bsik Virtual Laboratory for eScience (VL-e), SP2.1, Dutch-Russian NWO-RFBR # 047.016.007, 047.016.018 and DAS Distributed ASCI Super Computer.

Copyright © 2008 Valeria Khrzhanovskaya
Author contact: valeria@science.uva.nl, lera@csa.ru

Cover design by Svetlana Khrzhanovskaya
Back cover: plasma lamp by Luc Viatour from www.lucenix.be

Printed by PrintPartners Ipskamp, Enschede
To my family…